

ШЕРОХОВАТОСТЬ ТОНКИХ ПЛЕНОК АЛЮМИНИЯ, СФОРМИРОВАННЫХ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ

Г.А. Пименов, Д.Е. Шашин

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

МАГНЕТРОННОЕ РАСПЫЛЕНИЕ, ТОНКИЕ ПЛЕНКИ АЛЮМИНИЯ, ШЕРОХОВАТОСТЬ

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF RESIDUAL GAS PRESSURE ON THE ROUGHNESS OF THIN ALUMINUM FILMS FORMED BY MAGNETRON SPUTTERING

G.A. Pimenov, D.E. Shashin

KEYWORDS

MAGNETRON SPUTTERING, THIN ALUMINIUM FILMS, ROUGHNESS

В настоящее время металлические тонкие пленки широко применяются в различных областях электроники. Тонкие пленки используются в качестве функциональных покрытий и проводящих слоев в разных сферах, например, машиностроении, медицине, цифровой микроэлектронике. На данном этапе развития технологий получения металлических тонких пленок интенсивно развивается метод магнетронного распыления, обеспечивающий формирование тонких пленок с требуемыми функциональными характеристиками.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Пименов Григорий Андреевич – студент магистратуры радиотехнического факультета Поволжского Государственного Технологического Университета,

Шашин Дмитрий Евгеньевич кандидат технических наук, доцент Поволжского Государственного Технологического Университета (ORCID: 0000-0002-8222-2824), г. Йошкар-Ола респ. Марий Эл e-mail: grishapimenov71@gmail.com